趙天生教授/電子物理系

•辦公室位置:SC306

·實驗室位置:SC704 先進半導體製程與量測實驗室

• 學歷

1981-1985 交通大學電子工程系 學士

- 1987-1988 交通大學電子工程研究所 碩士直攻博士

1988-1992 交通大學電子工程研究所 博士

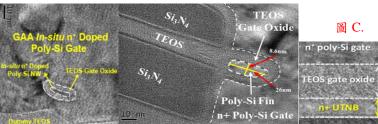
■ 經歷

- 1992-2001 國家臺微米元件實驗室 副研究員、研究員
- 1997-2001 工程與系統科學學系 兼任副、合聘教授
- 2001-2002 交通大學電子物理系 副教授
- 2002-2004 國家奈米元件實驗室 副主任
- 2009-2011 交通大學電子物理系系主任
- 2002-迄今 交通大學電子物理系 教授

•研究專長

- 半導體物理與元件
- 看體電路製程
- 薄膜電晶體
- 奈米元件

圖 A-2.







研究成果

圖 C.

n⁺ poly-Si gate

- A. 媲美單晶矽電特性之短通道(80nm)間極全環繞 超薄複晶矽奈米線無接面電晶體,有著低於一 伏的閘極操作電壓和接近理想的次臨界擺幅值。 (圖A)
- B. 可適用於3D垂直堆疊式多通道之具應變效應之 **側壁鑲嵌三閘極多晶矽鰭式無接面電晶體**,可 避免在深次微米電品體中,應力層厚度受到限 制。(圖B)
- C. 可適用於3D垂直堆疊式多通道之奈米帶無接面 電晶體,具有高的導通電流。(圖C)
- D. 新型掺雜方式之殼型掺雜輪廓無接面場效電晶 體,具有低的關閉電流和次臨界擺幅值。 (圖D)
- E. 具低功率功耗、低溫製造之新穎多晶矽穿隧薄 膜電晶體。(圖E)

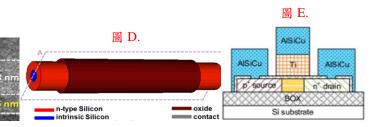


圖 A-1.

